

光電子分光装置 (X P S)

日本電子株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 地下1階分室1）



X線を材料表面に照射することにより、材料の最表面（深さ1～10ナノメートル）の化学結合状態についての情報を得ることができる装置です。薄層における化学結合状態の観察ができます。

装置の特長

- 高空間分解能XPS分析（30 μm ）から広域XPSイメージ（50 mm \times 18 mm）まで
- 磁界・電界インプットレンズによる高感度測定
- 高精度の波形分離ソフトウェアによる、容易な化学状態分析
- 全反射XPSによる高感度な表面極微量元素の測定

主な仕様

- 静電半球形アナライザ 中心軌道半径100 mm
- エネルギー掃引 0 ~ 1,500 eV
- CAE法 パスエネルギー 5 ~ 200 eV
- CRR法 E / E 0.15 ~ 0.5 %